

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成20年11月13日 (2008.11.13)

【公開番号】特開2002-201242(P2002-201242A)

【公開日】平成14年7月19日 (2002.7.19)

【出願番号】特願2001-296000(P2001-296000)

【国際特許分類】

C 0 8 F 291/00 (2006.01)

C 0 8 F 2/44 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 F 291/00

C 0 8 F 2/44 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年9月26日 (2008.9.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 3 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 3 9 】

実施例 3 :

反 応 物 質	量 (g)
A M P S	8 0
醋酸ビニル	2 0
シクロヘキサン	2 0 0
水	3 0 0
(^R) S p a n 8 0	1
N a ₂ S ₂ O ₈ (開始剤)	1
ポリ [N - ビニルピロリドン - <u>コ</u> アクリル酸) (3 0 / 7 0)	4

ポリマーを水中で乳化重合法によって製造する。この場合にはモノマーを水/シクロヘキサンに(^R) S p a n 8 0の使用下に乳化し、反応混合物をN₂で不活性化し、次いで反応を加熱後にペルオキシ二硫酸ナトリウムの添加によって開始する。ポリマーエマルジョンを次いで蒸留濃縮しそしてそれによってポリマーを単離する。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 4 0 】

実施例 4 :

反 応 物 質	量 (g)
N H ₃ で 中 和 し た A M P S	8 0
第 三 ブ タ ノ ー ル	3 0 0
N - ビ ニ ル ホ ル ム ア ミ ド	2 0
T M P T A	1 . 8
A B A H (開 始 剤)	1
ポ リ N - ビ ニ ル カ プ ロ ラ ク ト ン - <u>コ ー</u> ア ク リ ル 酸) (1 0 / 9 0)	<u>1 0</u>

ポリマーを第三ブタノール中で沈殿法によって製造する。この場合にはモノマーを第三ブタノールに最初に導入し、反応混合物を不活性化し、次いで反応を加熱後に A B A H の添加によって開始する。ポリマーを溶剤の吸引濾去および続いで減圧乾燥によって単離する。